



**MLE™ (MASKLESS EXPOSURE) TECHNOLOGIE VON EV GROUP WIRD AUF DER
PRODUCTRONICA / SEMICON EUROPA 2019 MIT DEM
GLOBAL TECHNOLOGY AWARD AUSGEZEICHNET**

Die bahnbrechende MLE™-Technologie von EVG bietet unübertroffene Flexibilität, Skalierbarkeit und Cost-of-Ownership-Vorteile im Vergleich zu existierenden High-Volume-Lithographieverfahren

ST. FLORIAN, Österreich, 12. November 2019 — EV Group (EVG), ein führender Entwickler und Hersteller von Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie, bekam heute für die wegweisende, maskenlose Exposure-Technologie MLE™ den GLOBAL Technology Award in der Kategorie Best Product – Europe vom Chefredakteur der Zeitschrift Global SMT&Packaging überreicht. EVG und weitere, ausgewählte Unternehmen wurden bei einer Preisverleihung während der productronica und SEMICON Europa 2019 in München ausgezeichnet. Dabei standen die innovativsten Produkte und Technologien im Mittelpunkt, die von den Herstellern von Equipment und Materialien für die Elektronikfertigung in den letzten 12 Monaten vorgestellt wurden.

Die MLE-Technologie von EVG ist eine revolutionäre Lithographie-Technologie der nächsten Generation, die für zukünftige Backend-Lithographie-Anforderungen bei Anwendungen im Bereich Advanced Packaging, MEMS, Bio- und Medizintechnik sowie High-Density-PCBs entwickelt wurde. Als weltweit erste hochskalierbare, maskenlose Lithographie-Technologie für die Hochvolumenfertigung bietet MLE unübertroffene Flexibilität, um extrem kurze Entwicklungszyklen für neue Produkte zu ermöglichen.

"Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung für unsere MLE-Technologie zu erhalten, die einen revolutionären Durchbruch in der Backend-Lithographie darstellt. Die heterogene Integration erhöht die Anforderungen an die Backend-Lithographie, was wiederum den Bedarf an neuen Lithographieansätzen erhöht, die keine Kompromisse bzgl. Leistung oder Kosten erforderlich machen. Unsere MLE-Technologie ist darauf ausgelegt, die zukünftigen Herausforderungen an die Backend-Lithographie zu meistern und alle Anforderungen an eine adaptive Strukturierung in Anwendungsbereichen wie Advanced Packaging und High-Density Interconnect PCBs zu erfüllen. Wir freuen uns, dass die Vorzüge dieser bahnbrechenden Technologie von den Preisrichtern anerkannt wurden", sagte Dr. Bernd Thallner, Corporate R&D Project Manager bei EV Group.

MLE ermöglicht die nahtlose, maskenlose Belichtung der gesamten Substratoberfläche mit hoher Auflösung (< 2 Mikrometer L/S) mit hohem Durchsatz und niedrigen Gesamtkosten (CoO). Das System ist entsprechend der Nutzeranforderungen durch die Hinzu- oder Wegnahme von UV-Exposureköpfen skalierbar, um so den schnellen Übergang vom Forschungs- und Entwicklungsstadium in die Hochvolumenfertigung zu erleichtern, den Durchsatz zu optimieren oder die Anpassung an unterschiedliche Substratgrößen und –Materialien zu ermöglichen. Zudem ist das System ideal für die Bearbeitung einer Reihe unterschiedlicher Substrate, von kleinen Silizium- oder Verbundhalbleiterwafern bis zu größeren Panels, geeignet. MLE erzielt bei der Strukturierung dank einer flexiblen und skalierbaren Hochleistungs-UV-Laserquelle mit mehreren Optionen bzgl. der Exposure-Wellenlängen unabhängig von den verwendeten Fotoresists stets die gleichen Leistungsdaten.

Weitere Informationen über die maskenlose Belichtungstechnologie MLE von EVG finden Sie unter <https://www.evgroup.com/de/technologien/mle-maskless-lithography/>



Kontakte:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com



EVG WINS GLOBAL TECHNOLOGY AWARD FOR MASKLESS EXPOSURE TECHNOLOGY...Page 2 of 2

About the GLOBAL Technology Awards

Since 2005, the annual GLOBAL Technology Awards presented by *Global SMT & Packaging* have recognized and celebrated the very best new innovations in electronics manufacturing equipment tools, services, and supplies on a global scale. A distinguished panel of industry experts select the products based on the finest examples of creative advancement in technology.

About EV Group (EVG)

EV Group (EVG) is a leading supplier of equipment and process solutions for the manufacture of semiconductors, microelectromechanical systems (MEMS), compound semiconductors, power devices and nanotechnology devices. Key products include wafer bonding, thin-wafer processing, lithography/nanoimprint lithography (NIL) and metrology equipment, as well as photoresist coaters, cleaners and inspection systems. Founded in 1980, EV Group services and supports an elaborate network of global customers and partners all over the world. More information about EVG is available at www.EVGroup.com.

Contacts:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com

###